

期刊信息	
篇名	Nitrogen plasma source ion implantation (PSII) for improvement of blood-compatibility of silicon
语种	英文
撰写或编译	
作者	P.Yang,G.J.Wan,X.Xie,Y.X.Leng,H.F.Zhou,P.K.Chu and N.Huang*
第一作者单位	
刊物名称	Key Engineering Mater
页面	288-289(2005), 335-
出版日期	2005年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	Si(C)-N系薄膜的血液接触活化机理及抗凝血优化